PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-113137

(43) Date of publication of application: 24.04.2001

(51)Int.CI.

B01D 61/48 C02F 1/44

C02F 1/469

(21)Application number: 11-295752

(71)Applicant: KURITA WATER IND LTD

(22)Date of filing:

18.10.1999

(72)Inventor: KONISHI AKIYOSHI

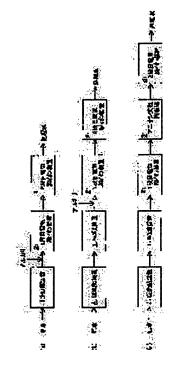
SATO SHIGEAKI

(54) PRODUCTION DEVICE OF HIGH PURITY OF WATER AND PRODUCTION METHOD OF HIGH PURITY OF WATER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce high purity of water having much higher purity and being stable in water quality for a long period.

SOLUTION: When raw water is successively passed through an RO membrane device 1, a first stage electric deionizing device 2 and a second stage electric deionizing device 3 to treat water, a decarboxylation device 4 is provided in the front stage of the RO membrane device 1; alkali is added to feeding water of the first stage electric deionizing device 2; or an anion exchange resin tower 5 is provided between the first stage electric deionizing device 2 and the second stage electric deionizing device 3.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.09.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号

特開2001-113137

(P2001-113137A)

(43)公顷日 平成13年4月24日(2001.4.24)

(51) Int.CL'		識別配号	FI		テーマコード(参考)
BOID	61/48		B01D	61/48	4D006
C02F	1/44		C 0 2 F	1/44	J 4D061
	1/469			1/46	103

審査部球 未請求 語水項の数6 OL (全 7 四)

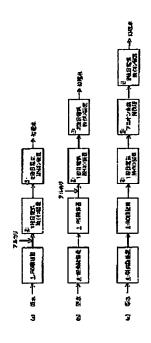
(21)出職番号	特顧平11−295752	(71) 出廢人	000001063
			采田工業株式会社
(22)出頭目	平成11年10月18日(1999.10.18)		東京都新宿区西新宿3丁目4番7号
		(72)発明者	小西 日魯
			東京都新宿区西新宿三丁目 4番7号 栗田
			工業旅式会社内
		(72) 発明者	佐藤 重明
			東京都新宿区西新宿三丁目 4番 7号 栗田
			工業株式会社内
		(74)代理人	100086911
			弁理士 選野 剛
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高額度水の製造装置及び高額度水の製造方法

(57)【要約】

【課題】 より高純度で水質の安定した高純度水を長期 に亘り連続的に製造する。

【解決手段】 原水をRO職装置1.1段目電気脱イオン装置2及び2段目電気脱イオン装置3に順次通水して処理するに当り、RO膜装置1の前段に脱炭酸装置4を設ける:1段目電気脱イオン装置2の結水にアルカリを添加する;或いは、1段目電気脱イオン装置2と2段目電気脱イオン装置3との間にアニオン交換削脂塔5を設ける。



3/30/2004

(2)

【特許請求の範囲】

【語水項 】】 逆浸透膜装置と該逆浸透膜装置の後段に 設けられた第1の電気脱イオン装置と、該第1の電気脱 イオン装置の後段に設けられた第2の電気脱イオン装置 とを有する高純度水の製造装置であって、

1

該逆浸透膜装置の前段に設けられた脱炭酸手段と、該逆 浸透膜装置と第1の電気脱イオン装置との間に設けられ たアルカリ添加手段とのいずれか一方又は双方を有する ことを特徴とする高純度水の製造装置。

設けられた第1の電気脱イオン装置と、該第1の電気脱 イオン装置の後段に設けられた第2の電気脱イオン装置 とを有する高純度水の製造装置であって、

該第1の電気脱イオン装置と第2の電気脱イオン装置と の間にアニオン交換装置を有することを特徴とする高純 度水の製造装置。

【請求項3】 請求項2において、該逆浸透膜装置の前 段に設けられた疑炭酸手段を有することを特徴とする高 純度水の製造装置。

【請求項4】 原永を逆浸透膜接置 第1の電気脱イオ 20 り とのような装置において、更に純度を向上するため ン装置及び第2の電気脱イオン装置に順次通水して高純 度水を製造する方法であって、

該道浸透膜装置への通水に先立つ原水の脱炭酸処理と、 該第1の電気脱イオン装置への通水に先立つ逆浸透膜装 置の処理水へのアルカリ添加とのいずれか一方又は双方 を採用することを特徴とする高純度水の製造方法。

【請求項5】 原水を逆浸透膜装置、第1の電気脱イオ ン装置及び第2の電気脱イオン装置に順次通水して高純米 * 度水を製造する方法であって、

該第1の電気脱イオン装置の処理水をアニオン交換処理 した後、該第2の電気脱イオン装置に通水するととを特 徴とする高純度水の製造方法。

【語求項6】 語求項5において、該逆浸透膜装置への 通水に先立ち原水を脱炭酸処理することを特徴とする高 純度水の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【請求項2】 道浸透膜装置と該逆浸透膜装置の後段に 10 【発明の属する技術分野】本発明は高純度水の製造装置 及び高純度水の製造方法に係り、特に、逆浸透(RO) 膜装置と、このRO膜装置の後段に2段に設けられた電 気臓イオン装置に原水を順次通水することにより、より 高純度で水質の安定した高純度水を連続的に製造する高 純度水の製造装置及び高純度水の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、RO磯装置と電気脱イオン装置と を組み合わせ、更に必要に応じて後段にイオン交換樹脂 塔を設けて高純度化を図った純水製造装置が公知であ

にRO膜装置を2段に設けたものや前段にアニオン交換 樹脂塔を設けたものも提案されている。

【0003】従来の装置構成において、シリカ20mg /し、ポロン0.2mg/L、比抵抗0.004MQ・ cm. 炭酸ガス約5mg/Lの原水を処理した場合、各 装置の処理水の水質は下記の通りである。

[0004]

【表1】

	原水	1段回 RO原装置 処理水	2於國 RO砂裝習 処理水	電気脱イオン装蔵 処理水
シリカ (mg/L)	20	1, 0	0 1	0 01
ポロン (mg/L)	O. 2	0. 02	0. 003	0. 000 5
比抵抗 (Mの·cm)	0. 004	0. 3	2.0	17 5

[0005]

(例2(14)の場合)

120.0,00,00					
	原水	RO模装置 処理水	電気脱イオン装置 処理水		
シリカ (mg/L)	20	10	0. 1		
ボロン (mg/L)	0. 2	C. 02	0.009		
比抵抗 (MQ·cm)	0. 004	U. 3	17. 0		

[0006] 【表3】

40

(図2(c)の場合)

(R)S(0)0)#	1501			
	原水	アニオン 交換樹端塔 処理水	RO脱装置 処理水	製気脱イオン装置 処理水
シリカ (mg/L)	20	0. 2	0. 02	0. 002
ポロン (mg/L)	0. 2	0. 92	0. 003	0. 0005
比抵抗 (MΩ·c:n)	0, 004	0, 004	0. 3	17. 6

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の純水製造装置では、シリカり、005mg/L以下、ボロンり、005mg/L以下、ボロンり、005mg/L以下、ボロンり、005mg/L以下、ボロンり、005mg/L以下、比越統17.5MQ・cm以上を処理水の水質の目標値とした場合、図2(a)に示す如く2段RO膜装置と電気脱イオン装置とを組み合わせたもの。及び、図2(b)に示す如くRO膜装置と電気脱イオン装置とを組み合わせたものでは、この水質の目標値に到達するためには、更に後段に非再生型液床式イオン交換装置等のイオン交換装置を設置する必要があり、そのための装置コストや設置スペースが問題となる。したの場合においても、ボロンの低濃度化は困難であり、また水質が安定せず、その上、イオン交換装置の交換や再生が必要であるために長期連続運転に適さないという欠点がある。

【①①①8】また、図2(c)に示す如くアニオン交換 制脂塔、RO膜鉄置及び電気脱イオン鉄置を組み合わせ たものでは、ほぼ目標水質に到達するが、RO膜鉄置の 前段のアニオン交換制脂塔の負荷が大きく、装置コスト や設置スペース。更にはアニオン交換樹脂の再生等の面 で不利である。

【①①①9】本発明は上記従来の問題点を解決し、より 高純度で水質の安定した高純度水を長期に亘り連続的に 製造することができる高純度水の製造装置及び高純度水 の製造方法を提供することを目的とする。

[0010]

【0011】 記求項2の高純度水の製造装置は、RO膜 装置と該RO膜鉄置の残段に設けられた第1の電気脱イ オン装置と、該第1の電気脱イオン装置の後段に設けられた第2の電気脱イオン装置とを有する高純度水の製造 装置であって、該第1の電気脱イオン装置と第2の電気 脱イオン装置との間にアニオン交換装置を有することを 特徴とする。

10 【0012】との請求項2の高純度水の製造装置において、RO順装置の前段に脱炭酸手段を設けるのが好ました。

【①①13】請求項4の高純度水の製造方法は、原水をRO機接置、第1の電気脱イオン装置及び第2の電気脱イオン装置に順次通水して高純度水を製造する方法であって、該RO機装置への過水に先立つ原水の脱炭散処理と、該第1の電気脱イオン装置への過水に先立つRO膜装置の処理水へのアルカリ添加とのいずれか一方又は双方を採用することを特徴とする。

6 【0014】請求項5の高純度水の製造方法は、原水を RO機装置、第1の電気脱イオン装置及び第2の電気脱 イオン装置に順次通水して高純度水を製造する方法であって、該第1の電気脱イオン装置の処理水をアニオン交換処理した後、該第2の電気脱イオン装置に通水することを特徴とする。

【①①15】との請求項5の高純度水の製造方法において、RO膜装置への通水に先立ち原水を脱炭酸処理するのが好ましい。

【0016】従来の純水製造装置では、電気脱イオン装置を1段のみで使用しているが、本発明においては、電気脱イオン装置を2段に直列に配置してシリカやボロンを高度に除去し、処理水の比抵抗を高める。即ち、電気脱イオン装置では、1段目の電気脱イオン装置では、1段目の電気脱イオン装置では、1段目の電気脱イオン装置では、1段目の電気脱イオン装置ではが小分に除去され、比抵抗も十分に向上した水を処理することになることから、2段目の電気脱イオン装置では原水(結水)条件が、性能面、回収率、電圧電流負荷に対して良好なものとなるため、得られる処理水の水質は著しく高くなり、水質が安定すると共に、長期連

【0017】なお電気脱イオン装置はコンパクトであるため、2段設けても装置設備が過度に大型化することはなく、設置スペース面でも問題になることはない。

【0018】しかも、本発明では、とのようにRO順装 置と2段に設けた電気脱イオン装置で処理するに当た

Ф 院炭酸処理することにより原水の炭酸ガス濃度を下
№2

第1の電気脱イオン装置の給水にアルカリを添加するととにより第1の電気脱イオン装置におけるシリカや

炭酸ガス除去率を高める。

③ 第1の電気脱イオン装置の処理水をアニオン交換処 理してより純度を高めると共に、アニオン交換処理によ りpHを高めた水を第2の電気脱イオン装置に始水する ことにより、第2の電気脱イオン装置においてシリカを 高度に除去する。ことで、著しく高純度の処理水を得る ことができる.

5

【①①19】即ち、原水を脱炭酸処理して電気脱イオン 装置の炭酸ガス負荷を軽減することで、電気脱イオン装 置の脱塩室内のイオン交換樹脂面及びイオン交換膜面で 10 のシリカ、ボロン、その他の塩類に対する吸者、移動速 度を向上させ、これらの除去性能を高めることができ

【0020】また、電気脱イオン装置の給水のpHを高 めることにより、炭酸ガスが重炭酸イオンに変化する と、電気脱イオン装置の脱塩室から濃縮室側へ容易に移 動するようになり、脱イオン効率が高まる。

【①①21】特に、前処理として脱炭酸装置を設けて原 水の炭酸ガス濃度を下げ、また、1段目電気脱イオン装 置と2段目電気脱イオン装置との間にアニオン交換制脂 20 度の処理水を得ることができる。 塔を設置することにより、2段目電気脱イオン装置の給 水のp目を高め、かつ、シリカ、ボロン、炭酸ガスを見 に除去することとなり、その結果、シリカトータル除去 率99.999%以上、ボロントータル除去率99%以 上、比抵抗値17.5ΜΩ・c n以上の陰能を確実に得 るととができ 2段目電気脱イオン装置の処理水とし て、シリカ濃度0、0001mg/L以下、ボロン濃度 0.0001mg/L以下,比抵抗値18.0MΩ・c mと若しく高純度の処理水を得ることができる。

[0022]

【発明の真施の形態】以下に図面を参照して本発明の真 施の形態を詳細に説明する。

【0023】図1(a)~(c)は本発明の高純度水の 製造装置及び高純度水の製造方法の実施の形態を示す系 練団である。

【10024】本発明において、処理する原水は、市水 (水道水)、地下水(弁戸水)、河川水、その他使用済 純水の回収水等である。

【10025】図1 (a) の高純度水の製造装置は、原水 をR O膜装置 1、1段目電気脱イオン装置 2及び 2段目 40 電気脱イオン装置3に順次通水して処理するに当たり、 1段目電気脱イオン装置2に給水されるRの膜装置1の 透過水にNaOH、KOH等のアルカリを添加して1段 目電気脱イオン装置2の結水のp Hを6. 5以上、好ま しくは8.0~12.0に調整して処理を行うものであ

【0026】図1(b)の高純度水の製造装置は、図1 (a)の高純度水の製造装置に更に前処理装置として脱 炭酸装置4を設け、原水を脱炭酸処理した後、RO膜袋 オン装置2及び2段目電気脱イオン装置3に順欠道水し て処理するものである。

【0027】図1(c)の高純度水の製造装置は、図1 (b) の高純度水の製造装置において、アルカリ添加の 代りに1段目電気脱イオン鉄置2と2段目電気脱イオン 装置3との間にアニオン交換樹脂塔5を設け、原水を脱 炭酸装置4で脱炭酸処理した後、RO膜装置1.1段目 電気脱イオン装置2、アニオン交換樹脂塔5及び2段目 電気脱イオン装置3に順次追水して処理するものであ る.

【0028】本発明においては、このように、原水をR 〇膜装置 1, 1段目電気脱イオン装置 2及び 2段目電気 脱イオン装置3に順次通水して処理するに当たり、アル カリ添加、脱炭酸処理、アニオン交換処理を組み込むこ とにより、1段目電気脱イオン装置2及び/又は2段目 電気脱イオン装置3の給水が好ましくは次のような水質 となるように調整し、1段目電気脱イオン装置2の水回 収率を50~95%、2段目電気脱イオン装置3の水回 収率を50~96%で通水することにより、著しく高純

[0029]

【表4】

X.1					
	硬度 (mg/L)	≺ 5. 0			
	シリカ (mg./L)	<2.0			
1段目の	炭酸ガス(mg/L)	<2. 0			
電気限イオン装置 の給水条件	比抵抗(MΩ·cm)	>0. 01			
	рН	>6 5			
	水温 (℃)	5~50			

[0030]

【表5】

30

	硬度(mB/L)	<5 0
	シ/肋 (mg/L)	<1.0
2段目の	炭酸ガス(mg/L)	<2.0
電気配イオン装置 の給水条件	比抵抗(MΩ ·cm)	>0. 01
	ρΗ	>6. 5
	水温 (℃)	5~50

【①①31】従って、本発明では、電気脱イオン装置の 給水として上述のような水質範囲が達成されれば良く、 例えば、図l(b)の高純度水の製造装置において、ア ルカリ添加を省略しても良く、また. 図1 (c) の高純 度水の製造装置において、脱炭酸装置を省略しても良

【0032】なお、上記水質を確保する上で、原水は必 置1で処理し、アルカリでpH調整後、1段目電気脱イ、50、要に応じて除濁装置、活性炭塔、或いは軟水器等で前処

(5)

特闘2001-113137

8

難した後、本発明に従って処理するのが好ましい。

[0033]

【実施例】以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明する。

【① 0 3 4】なお、以下において、原水としては、上水 (井水)を活性炭塔で処理した後、軟水器で硬度成分を 除去した水(水温21~24℃)を用いた。この原水の 水質は次の通りであり、処理水登は400上/hrとし

ĸ.

【原水水質】

シリカ : 30mg/L ボロン : 0.05mg/L 炭酸ガス: 8mg/L

pH : 7.2

比低抗 : 0. 004MΩ·cm

また。用いたRO順装置、1段目電気脱イオン装置、2 段目電気脱イオン装置、脱炭酸装置及びアニオン交換樹 脂塔の仕様及び運転条件は次の通りである。

【0035】R〇膜装置:低圧スパイラル型モジュー

ル、ポリイミド系合成複合膜

水回収率: 30%

通水圧力: 6.4 kg/cm² (6.27×10⁵ P

a)

1 段目電気脱イオン装置:脱塩室と濃縮室にアニオンと※

*カチオンとの混合イオン交換樹脂を充填したオールフィ

ルド壁

水回収率: 88% 弯圧 : 98V 弯流 : 0.4A

2段目電気脱イオン装置: 1段目電気脱イオン装置と同

じ型を使用

水回収率: 90% 電圧 : 100V 10 電流 : 0.04A

脱炭酸基置:外圧式中空糸型脱気膜(機材質:ポリプロ

ピレント

アニオン交換樹脂塔: 強塩基性アニオン交換樹脂量15

L (1基) 実籍例1

図1(a)に示す高純度水の製造装置で原水を処理した。アルカリとしてはNaOHを用い、1段目電気脱イオン装置2の結水のpHが9となるように添加した。

【0036】各段階における水質及び除去率は次の通り 20 であった。なお、除去率は原水中の濃度に対して各段階

における濃度から求めた値である。

【0037】 【表6】

		RO膜装置1 の透過水 (アルカリ添加前)	1段目電気脱イオン装置2 の 給 水 (アルカリ添加数)	1度目電気脱イオン装置2の 処 理 水	2限日電気脱イオン装置S の 場 理 水
シリカ	漫度 (mg/L)	0. 98	O. 98	0, 95	¢. 0035
2773	(96)	97	_	99 8	99. 89
ポロン	悲度 (mg/L)	0, 015	0. 015	0. 0009	0, 0001
水ロン	除去率 (%)	70	_	96. 2	99. 8
	ガス譲度 18✓L)	6	<0. 05	<0.05	<0.05
	pН	6.9	9	7. 2	_
	L媒执 Ω·cin)	03	0 03	12. 0	17 6

[0038]実施例2

図1(c)に示す高純度水の製造装置で原水を処理した

った。

[0039]

ところ、各段階における水質及び除去率は次の通りであ 40 【表7】

特闘2001-113137

		脱炭酸液液4 の処理水	RO腕装置1 の透過水	1 段 日 電気段イオン装画2 の 処 ឃ 水	アニオン交換福職 55 の 毎 恵 水	2 段 目 電気脱イオン袋造3 の 母 艰 水
シリカ	温度 (mg/L)	30	0, 68	0 05	0. 005	<0.0001
נגניע	华去의 (%)	_	97	99. 8	99. 98	99. 939<
	護度 (mg/L)	0. 05	0.015	O. 0008	0. 0001	<0.0001
ポロン	除投車 (%)	_	70	98. 2	9D. 8	99. 8<
	ガス波度 セ/し)	1. 8	1 5	<0. 05	<0, 05	<0.05
	p⊩l	7 9	7. 3	7. 3	8	_
	t抵抗 Q·cm)	0.004	03	10	12	16. 0

【0040】比較例1

図2(り)に示す高純度水の製造装置で原水を処理し た。なお、電気脱イオン装置としては脱塩室と遊檔室に アニオンとカチオンの混合イオン交換樹脂を充填したオ ールフィルド型を用い、水回収率85%、電圧115 V、電流0.5Aで処理を行った。

9

【① ① 4 1 】 各段階における水質及び除去率は次の通り 20 【図面の簡単な説明】 であった。

[0042]

【表8】

		RO観撃選 の透過水	電気脱イオン装置 の 強 理 水			
シリカ	遠度 (mg/L)	0. 98	0. 15			
2777	率左邻 (%)	97	99. 5			
ポロン	速度 (mg/L)	0. 015	0, 0023			
ボロン	除去路 (%)	70	95 4			
	ガス造度 セグL)	6	<u> </u>			
рΗ		6	_			
	;接抗 Ω·cm)	0. 3	17. 0			

[0043]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明によれば、よ り高純度で水質の安定した高純度水を長期に亘り連続的 に製造することができるため、後段の装置設備の負荷を 軽減して装置のコンパクト化、設備コストの低減を図る ことができる。

【図1】本発明の実施の形態を示す系統図である。

【図2】従来例を示す系統図である。

【符号の説明】

1:RO膜装置

2:1段目電気脱イオン装置

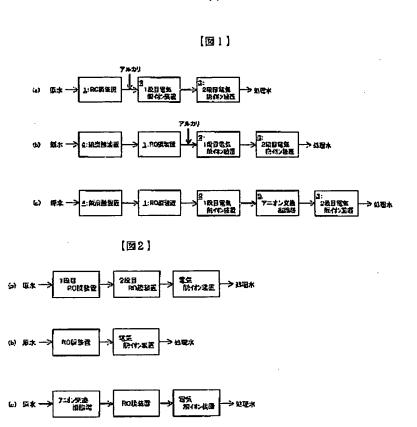
3:2段目電気脱イオン装置

4:脱炭酸装置

5:アニオン交換制脂塔

(7)

特闘2001-113137



フロントページの続き

F ターム(参考) 40006 GA03 KA02 KA71 KA72 KB11 KB17 PB23 PB70 PC02 40061 DA02 DB15 DC13 DC18 EA09 EB13 FA09 FA20